

Науковий редактор:
Фареник В.І.

Редактори тематичних напрямків:
Азаренков М.О.
Гладких М.Т.
Задорожний Г.В.
Неклюдов І.М.
Сагалович В.В.
Свіч В.А.

Наукове видання
**Фізична
інженерія
поверхні**

**Физическая
инженерия
поверхности**

**Physical
surface
engineering**

Видається 4 рази на рік
Издается 4 раза в год
4 issues yearly

Мови видання: українська, російська або англійська
Языки издания: украинский, русский или английский
Journal's languages: Ukrainian, Russian, or English

Тематичні напрямки:

- фізика поверхні – модифікації, покриття, плівки, приповерхні і перехідні шари різних видів, як результат впливу плазми, корпускулярно-фотонних потоків і випромінювання;
- взаємодія різноманітних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків;
- фізика і техніка низькотемпературної плазми;
- фізика і техніка лазерів;
- фізичні властивості плівок і покриттів;
- нанофізика, мікро- і нанотехнології, мікро- і наноелектроніка;
- фізичні та технічні аспекти сучасних технологій обробки поверхні, діагностики і контролю технологічних процесів.

Тематические направления:

- физика поверхности – модификации, покрытия, пленки, приповерхностные и переходные слои различных видов, как результат воздействия плазмы, корпускулярно-фотонных потоков и излучения;
- взаимодействие разнообразных видов излучения с поверхностями металлов, полупроводников, диэлектриков;
- физика и техника низкотемпературной плазмы;
- физика и техника лазеров;
- физические свойства пленок и покрытий;
- нанофизика, микро- и нанотехнологии, микро- и нанoeлектроника;
- физические и технические аспекты современных технологий обработки поверхности, диагностики и контроля технологических процессов.

Topic directions:

- surface physics - modification, coating, film, near-surface and transient layers of different kinds, as outcome of influencing of plasma, corpuscular - photon flows and radiation;
- interaction of miscellaneous kinds of radiation with surfaces of metals, semiconductors, dielectrics;
- physics and engineering of low-temperature plasma;
- physics and engineering of lasers;
- physical characteristics of films and coatings;
- nanophysics, micro and nanoelectronics, micro and nanotechnologies;
- physical and engineering aspects of modern technologies of surfacing, diagnostic and control of technological processes.

Керівник редакційно-видавничого відділу Чуєнкова Н.П.

Комп'ютерний макет: Антонюк Л.В., Беляєва Т.М., Дудіна Н.Г., Положій Л.А., Турбін П.В.
Оригінал-макет виготовлено в Науковому фізико-технологічному центрі МОН та НАН України,
вул. Новгородська, 1, м. Харків, 61145, Україна

Підписано до друку 31.03.2003 р. Формат А4. Папір офсет № 1. Гарн. тип Times. Офсетний друк.

Умовн. друк арк. 14,2. Обл.-вид. арк.16,5. Ціна договірна. Зам. /2003. Наклад 300.

Надруковано: в РВЦ Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

вул. Миросицька, 1, м. Харків, 61002, Україна